

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局(43) 国際公開日
2005年1月13日 (13.01.2005)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 2005/003026 A1

- (51) 国際特許分類: C01B 25/238, 25/20
 (21) 国際出願番号: PCT/JP2004/009112
 (22) 国際出願日: 2004年6月28日 (28.06.2004)
 (25) 国際出願の言語: 日本語
 (26) 国際公開の言語: 日本語
 (30) 優先権データ:
 特願2003-189631 2003年7月1日 (01.07.2003) JP
 (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 日本化学工業株式会社 (NIPPON CHEMICAL INDUSTRIAL CO., LTD.) [JP/JP]; 〒1368515 東京都江東区亀戸9丁目1番1号 Tokyo (JP).
 (72) 発明者; および
 (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 石川 賢一

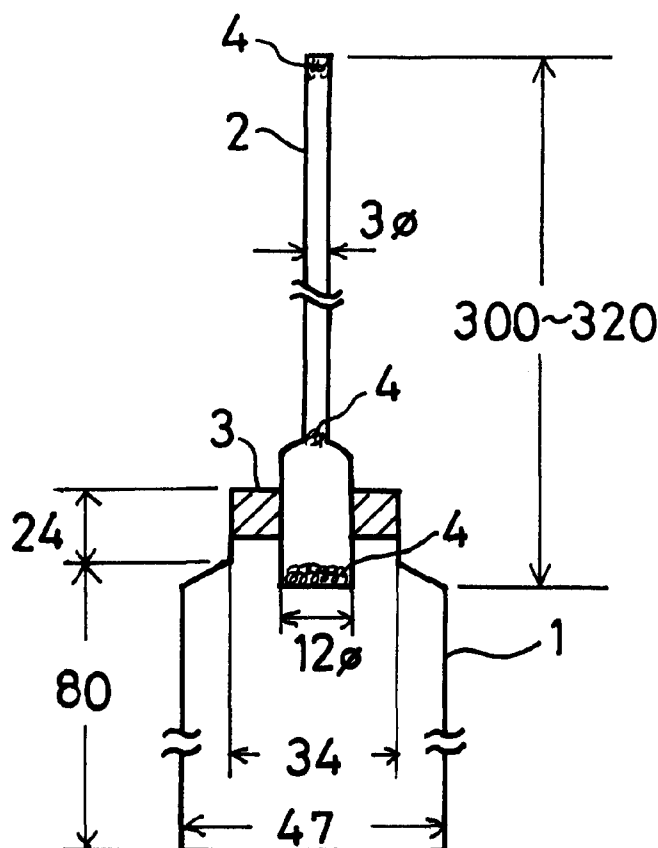
(ISHIKAWA, Kenichi) [JP/JP]; 〒4702513 愛知県知多郡武豊町字一号地17-1 日本化学工業株式会社 愛知工場内 Aichi (JP). 横井 敬三 (YOKOI, Keizou) [JP/JP]; 〒4702513 愛知県知多郡武豊町字一号地17-1 日本化学工業株式会社 愛知工場内 Aichi (JP). 竹内 宏介 (TAKEUCHI, Kosuke) [JP/JP]; 〒4702513 愛知県知多郡武豊町字一号地17-1 日本化学工業株式会社 愛知工場内 Aichi (JP). 栗田 裕 (KURITA, Hiroshi) [JP/JP]; 〒4702513 愛知県知多郡武豊町字一号地17-1 日本化学工業株式会社 愛知工場内 Aichi (JP). 内山 平二 (UCHIYAMA, Heiji) [JP/JP]; 〒1368515 東京都江東区亀戸9丁目1番1号 日本化学工業株式会社 研究開発本部内 Tokyo (JP).

- (74) 代理人: 羽鳥 修, 外 (HATORI, Osamu et al.); 〒1070052 東京都港区赤坂一丁目8番6号赤坂HKNビル6階 Tokyo (JP).

[続葉有]

(54) Title: HIGH PURITY PHOSPHORIC ACID AND METHOD FOR PRODUCTION THEREOF

(54) 発明の名称: 高純度リン酸及びその製造方法



(57) Abstract: A high purity phosphoric acid, characterized in that it has an impurity content wherein the content of Sb is 200 ppb or less and the content of a sulfide ion is 200 ppb or less, in terms of a product having a H_3PO_4 concentration of 85 wt %. The above high purity phosphoric acid is useful as an etching fluid for a semiconductor element having a silicon nitride film, an etching fluid for a liquid crystalline display panel having an alumina film, an etching fluid for metallic aluminum, an etching fluid for alumina for a ceraminc, a material of a phosphate glass for an optical fiber glass, a food additive and the like.

(57) 要約: 本発明の高純度リン酸は、 H_3PO_4 の濃度を85重量%に換算したときの不純物含量として、Sbが200ppb以下であり且つ硫化物イオンが200ppb以下であることを特徴とする。本発明の高純度リン酸は、窒化珪素膜を有する半導体素子のエッチング液、アルミナ膜を有する液晶ディスプレイパネルのエッチング液、金属アルミニウムエッチング液、セラミックス用アルミナエッチング液、光ファイバガラス用リン酸ガラス原料、食品添加物等として有用である。

WO 2005/003026 A1



(81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY,

KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

— 国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。